

公開シンポジウム 戦略的創造研究推進事業さきがけ

「革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス」研究成果報告会

次世代革新的デバイス創成を指向した 物理とテクノロジーの探索

第71回 応用物理学会学術講演会
応用物理学会・JST共同企画シンポジウム

日時：2010年9月15日（水）10：00～17：30

会場：長崎大学文教キャンパス工学部1号館1F-12講義室
長崎市文教町1-14

環境やエネルギー消費に配慮しつつ高速・大容量かつ高度な情報処理・情報蓄積・情報伝達を実現するために、CMOSに代表される既存のシリコンデバイスを超える革新的な次世代デバイスの創成が強く求められています。本シンポジウムでは、将来のデバイス化に向けた新しい物理とテクノロジーの開拓をテーマとして、若手研究者を中心に議論します。対象としてはスピントロニクス材料、強相関材料、ナノカーボン、有機半導体材料などの作製・評価やプロセスの開拓およびデバイス応用を含みます。

なお本シンポジウムは科学技術振興機構（JST）の戦略的創造研究推進事業さきがけ「革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス」研究領域（研究総括 佐藤勝昭）の第1期の研究成果の発信を兼ねて実施されるもので、JSTと応用物理学会の共同企画で行われます。



社団法人 応用物理学会
独立行政法人 科学技術振興機構(JST)